

New Release

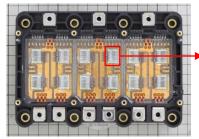
LTEC Corporation

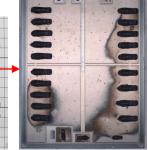
Your most experienced partner in IP protection

富士電機製_EV、HEV用IGBT モジュール「6MBI800XV-075V-01」

構造解析、プロセス、デバイス特性解析レポート







製品外観

製品内部

チップ写真

<u>製品概要</u>

富士電機製 車載用 Vces=750V Ic=800A IGBTパワーモジュール。
IGBTチップは同社の第7世代XシリーズRC-IGBT(Reverse Conducting IGBT)を使用し、水冷構造は第3世代直接水冷構造を採用しています。

解析のポイント

- ・モジュール解析レポートではモジュールの内部構成を確認し、RC-IGBTの配置及び レイアウトを明らかにしています。また、冷却器の構造および内部構成を明らかにして 放熱メカニズムの推定も行っています。
- ・チップ構造解析レポートではRC-IGBTのIGBT、FWD領域の平面レイアウトおよび、 断面構造を明らかにしています。
- ・プロセス解析レポートではRC-IGBTのプロセス技術に関する考察、マスク枚数及び 製造プロセスフローを推定しています。また、IGBTとFWDと温度センサがどのように 集積しているかを明らかにしています。
- •RC-IGBTのIce-Vce特性、オフ状態コレクタリーク電流及びブレーダウン電圧をそれぞれ 測定し、オフリーク電流の温度依存性から活性化エネルギーを算出。 インフィニオン社製 IGBT7と比較しています。

各レポート価格

OIGBTモジュール構造解析レポート: 30万円(税別)

ORC-IGBTチップ構造解析レポート:50万円(税別)

※モジュール構造レポート + チップ構造レポートのセット購入の場合:70万円(税別)

ORC-IGBTチップのプロセス、デバイス特性解析レポート: 40万円(税別)



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

RC-IGBTモジュール構造解析レポート

【目:	次】		頁
1		表1:デバイスサマリー(モジュール)	3
	1-1	解析概要	4-5
		表2:モジュール断面構造概要	6
2		モジュール外観観察	7
	2-1	外観観察	8-10
3		モジュール構成	11
	3-1	モジュール内部観察	12-20
	3-2	モジュール構成図	21-22
4		冷却法、構成	23-24
	4-1	冷却器観察	25-29
	4-2	冷却構成	30-32
5		モジュール断面構造・材料分析(EDX)	33
	5-1	断面観察	34-61
	5-2	モジュールEDX分析結果	62-82
6		関連特許目録	83-84



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 e-mail: info@ltec.biz 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8 ホームページ: www.ltec.biz

RC-IGBTモジュールIGBTチップ構造解析レポート

【目	次】	頁
1	デバイスサマリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	1-1. 解析結果まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-7
	表2:デバイス構造: Si IGBT ······	8
	表3:デバイス構造: Si FWD ······	9
	表4:デバイス構造: レイヤー材料・膜厚	10
2	搭載チップ概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
	2-1. 搭載チップ比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12-21
	2-2. チップ面積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22-24
3	Si IGBTチップ解析 ・・・・・・・・・・・・	25
	3-1. 平面構造解析(OM) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26-78
	3-2. 平面構造解析(SEM)	
	チップコーナー部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79-80
	チップ端部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81-83
	IGBT領域 ······	84-93
	IGBT-FWD境界 ······	94-97
	FWD領域 ······	98-99
	電流センスセル部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100-106
	温度センスダイオード部 ・・・・・・・・・・・	107-108
	3-3. 断面構造解析(SEM)	
	断面加工箇所	109
	チップ厚 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110
	セル部断面まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	IGBT領域 ······	112-121
	IGBT-FWD境界 ······	122-123
	FWD領域 ······	124-125
	チップ裏面部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126-129
	チップ端部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130-141
	温度センスダイオード部 ・・・・・・・・・・・	142-146
4	4-1. セル部EDX分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147-156
5	5-1. 追加解析リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157-158



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

RC-IGBTモジュールIGBTプロセス、デバイス特性レポート

【目	次】		頁
1		Fuji Electric RC-IGBT(6MBI800XV-075V-01)	
		ェグゼクティブサマリー [゛] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-4
	1-	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-6
2		RC-IGBTデバイス構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	2-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8
	2-		9
	2-		10-13
	2-	· =:->-	14-15
	2-		16
3		プロセス技術に関する観察と考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
	3-	TO TO THE CONTRACT THE PROPERTY OF	18
	3-		19
	3-	7 TO THE CONTRACT OF THE CONTR	20-22
	3-		23
	3-		24-25
	3-	1, 70.7	26
	3-		27
4		製造プロセスフロ一解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	4.	(12.2)	29
	4.		30
	4.	m - 15122 110 110 110 110 110 110 110 110 110	31-35
	4.		36-39
5		電気特性評価 ·····	40-42
	5-	l 電気特性評価:lc-Vce特性······	43-44
	5-	2 電気的特性:オフ状態のコレクタ電流の温度とコレクタ電圧依存性・・・・・・・・・	45
	5-	3 電気的特性:オフ状態のコレクタ電流の温度依存性と活性化エネルギー・・・・・・・	46
	5-	4 電気的特性:オフ状態のコレクタ耐圧電圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	5-	g- =	48-49
6		関連文献目録 ·····	50
7		関連特許目録 ·····	51-61



●モジュール構造解析レポートからの抜粋(1)



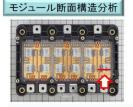


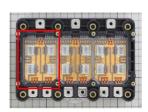


Fig. 1-1-4 モジュール断面概略図

測長結果 ワイヤ IGBT 上部金属層 ろう材 絶縁層 添加物 ろう材 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5 半田 6 冷却器 下部金属層 6-1 メッキ ベース板 6-2 6-3 ろう材 6-4 フィン ろう材 6-5 ジャケット

表2: モジュール断面構造概要

3-1. モジュール内部観察



X方向寸法

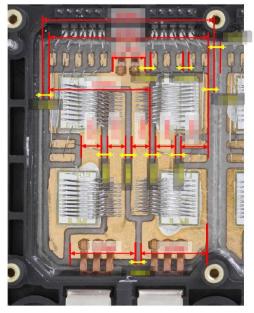


Fig. 3-1-6 モジュール内部拡大



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目<u>42-8</u>

モジュール構造解析レポートからの抜粋(2)

富士電機 6MBI800XV-075V-01 4. 冷却法、構成 o D D o D D o D o 冷却器X線像(正面) 放熱イメージ図(モジュール断面)

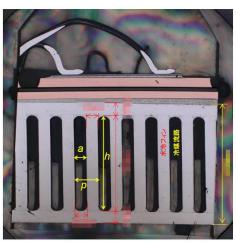
Fig. 4 放熱概要

CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF A STREET AND ADMINISTRATION OF A STREET

4-1. 冷却器観察







対流の実効的な熱伝達係数 her は冷却器の構造と 冷媒によって決まる

- ·寸法: a, h, p
- ·体積流量G [L/min]

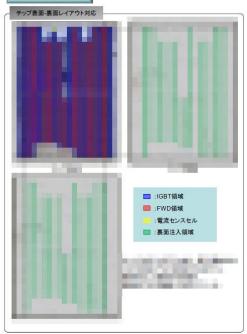
Fig. 4-1-4 冷却器断面OM像

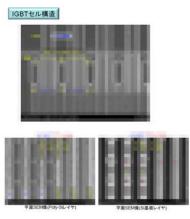


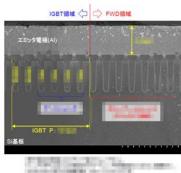
株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

●チップ構造解析レポートからの抜粋

IGBTチップ構成

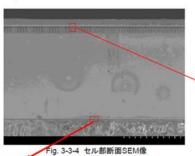






3-3. 断面構造解析(SEM)

セル部断面まとめ





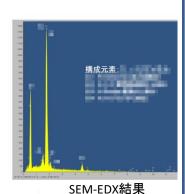


Fig. 3-3-6 セル部断面SEM像(IGBT領域)

	SI基板
※8 ※9	裏面電極-1 裏面電極-2
4- 2- A	14 17 190
	ダイアタッチ

Fig. 3-3-5 裏面断面SEM像(IGBT/FWD境界)

	測定箇所	測長結果	材料
11	IGBT	FEE. 1	
	保護膜 ※	10000 00	STREET, SQUARE, SQUARE
1	表面電極	10000 100	
2	層間絶縁膜	100 0	
3	コンタクトブラグ	10000	
4	バリアメタル	1 10 100	
5	Gate電極	100	0.010
6	Gate絶縁膜	100	
7	基板	1800	
В	裏面電極-1		100
9	裏面電極-2		



●プロセス、デバイス特性解析レポートからの抜粋

Fuji Electric

3-5. プロセス技術に関する観察と考察

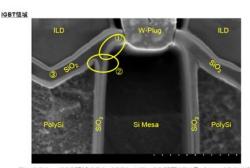
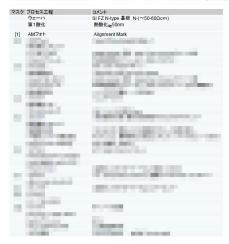


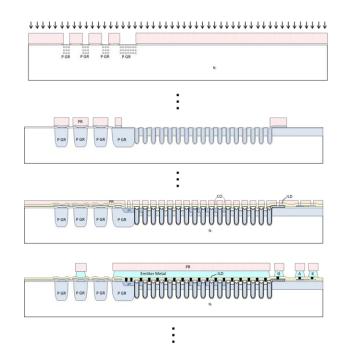
Fig. 3-5-2 IGBT領域のRC-IGBTセルアレイの断面SEM像 トレンチとSiメサの詳細

- ①トレンチトップの丸みが観察される⇒ ②Trench PolySi-sidewallでの「バーズビーク」あり⇒ ③トレンチPolySiおよびSi Mesa上のSiO2 (~250nm)→

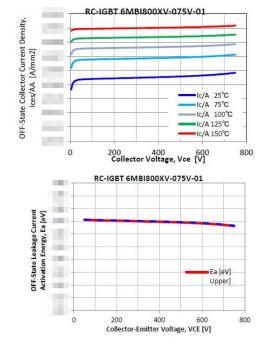
4. 製造プロセスフロ一解析 4-1. Si-RC-IGBTのフロントエンドウェーハプロセスフロー(推定)



Wafer processing up to back-metallization: photo/masking steps ・チッププロセスレベル: 枚マスク(層)



プロセスフローシークエンス図



単位面積当たりのオフ状態のコレクタリーク電流 および活性化エネルギーの算出



Phone: 072-787- 7385 株式会社エルテック 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8